

# 界面ナノ電子化学 進化する半導体ウェットプロセス シリコンから化合物まで



本シンポジウムは、化合物半導体を取り扱う方々にはシリコンで洗練された世界に誇る日本の半導体洗浄技術を知って頂く機会として、シリコンのウェットプロセスに携わってきた方々には、その技術を化合物半導体へ広げる機会として、両者の交流を目的とし開催します。皆様のご参加をお待ちしています。

9/13(日)  
13:15開始  
会場1B

## 招待講演

- 13:30 **パワーを制する者が未来を制する – Siも、SiCも、GaNも –**  
湯之上 隆（微細加工研究所）
- 14:15 **ナノ界面とマクロ挙動を繋ぐ感性と科学とシミュレーション**  
黒田 孝二（京都工芸繊維大学）
- 15:15 **SiCの洗浄技術について**  
木下 博之（京都工芸繊維大学）
- 15:45 **溶融塩電気化学プロセスによる「炭素めっき」**  
辻村 浩行（アイ'エムセップ）

## 一般講演

- 16:30 **シリコン酸化膜の枚葉洗浄によるチャージアップ挙動**  
川上 雅之（オルガノ）
- 16:45 **SiO<sub>2</sub>の固体壁面における水およびアルコールの吸着挙動の分子動力学解析**  
中岡 聡（阪大工）
- 17:00 **ジャパンソニックでの微細化洗浄の課題**  
山本 義治（ヤマトテクノス）
- 17:15 **IPA中極微量金属汚染の分析手法**  
伊藤 雄大（東京エレクトロン）

企画：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会